

# 日本Savina MX擦拭布HITECLOTH光学镜头拭镜布SOLIV

产品名称	日本Savina MX擦拭布HITECLOTH光学镜头拭镜布SOLIV
公司名称	深圳市宝安区民治庆高科技商行
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道白石龙二区162号首层102
联系电话	0760-88615813 13728675509

## 产品详情

日本KBSEIREN Savina MX擦拭布

Savina Minimax是日本KBSEIREN株式会社（原KANEBO）开发的目前最gaoji的无尘擦拭布系列产品，吸水吸油性极强，不磨损原件。广泛用于光学镜头制造，办公器材保养，10级以上的无尘车间净化室，半导体生产线车间等领域。cleanroom wiper

日本KANEBO公司生产的HITECLOTH 超细纤维无尘布是由Belima.X织成，其不规则的纤维排布组成适用于各种不规则物体的细微表面处理，不会掉绒毛，超柔软布质及高度抗磨损特性可应用于精密仪器之保养

规格：24CM X 24CM

包装：100片/包 高科技领域正日益精密和复杂。对于LSI和LCD等产品生产过程中所需的严格无尘环境而言，高效擦拭布是必备要素。Savina MX能够轻松满足时代需求，具有出色的功能，足以应对超级无尘室中的极端无尘条件。

无尘室中所使用的擦拭布应当能够清洁所有仪器、器械和外围设备，同时不会造成污染。擦拭布还要能够吸收并清除多余的水分。Savina MX具备此类擦拭布所需的所有属性，是性能zuihao的擦拭布之一，专为高科技时代而设计。

超级高收缩、高密度整理产品

## Savina MX的横截面

## Savina MX的表面

Savina MX在专门的细针距针织机上编制而成，其坯布横向和纵向的收缩率均达到其原始尺寸的40%。它未经任何粘合剂处理，就达到了这样的致密结构。所得擦拭布表面积高达25,700 cm<sup>2</sup>/g，从而确保了在不掉毛的情况下清除灰尘。而传统擦拭布的表面积仅为2,420 cm<sup>2</sup>/g

## 特色

掉毛量极少。

迅速而积极地吸收并留住水分。

残留离子和其他物质的溶解率较低。

具备高端的擦拭布性能（灰尘清除量最大，同时不会污染无尘室设备）。

## 用途

光磁盘、硬盘和软盘的生产过程

液晶偏转板以及其他物品的生产过程

光盘和磁盘的生产过程

录像机的生产过程

隐形眼镜的生产过程

相机装配线

印刷电路板的清洁工艺

相机镜头镀膜前的清洁工艺

药品生产线清洁工艺

电影胶片清洁工艺

半导体和基础电路的生产过程

精密涂层之前工件的清洁过程